技術情報シート

1. 技術の名称	半導体製造装置用ダミー・モニターウェハ(200mm、300mm)のリサイクル技術
2. 技術の内容	半導体製造工程で使用しているダミー・モニターウェハのリサイクルを可能としています。 再生研磨量を最小化する事で利用回数の増加、新品ウェハ購入量削減に貢献致します。
3. 技術の概要	
技術の目的・用途、技 術の特長、実績、価格	【技術の目的・用途】 半導体製造工程のダミー・モニター用ウェハにおいて、使用後の付着膜を独自のケミカルで除去し、廃棄されていたウェハのリサイクルを実現します。更に表面ダメージ層を薄表研磨で除去し、ウェハの長期再利用を実現します。また再生できないウェハは太陽電池用ウェハ及び Si 原料として活用致します。 また再生できないウェハは太陽電池用ウェハ及び Si 原料として活用致します。 「対サイクルフロー」 「成歳・研薦) 「中本処理 (成歳・研薦) 「中本処理 (成歳・研薦) 「中本の分析と高選択性エッチング液の開発技術 ② 薄表研磨 (自社開発の枚業研磨技術) ③ 短納期でのご返却(ウェハ予備在庫の最少化を実現) 【実績】 日本国内、中国、台湾等の各半導体メーカー様 【価格又はその問い合わせ先】 お問合せ先:株式会社新菱 ウェハテクノ事業部門 企画営業部 担当 小西 伸清 電話番号 093・643・2778 Mail 6008513@shinryorgr.com
①用途分類	リサイクル(マテリアル)
②対象廃棄物	電子製品
③提供役務	その他
5. 本技術に関するサー	
ビス提供が可能な国	アジア地域(中国、台湾、韓国、シンガポール)を中心に全世界可能。
6. 検索キーワード	ウェハ、リサイクル、再生、研磨、洗浄、ダミー、モニター
7. 問合先窓口・担当者	上記 3.【価格又はその問い合わせ先】をご参照下さい。